1. Injection device for the metered injection of two liquids into a reaction chamber having a housing (1) that has an injection nozzle whose nozzle opening (13) forms an injector with valve seat (14) in the housing (1) and with a valve body (15) that may be mounted on the valve seat (14), the valve body (15) being movable via an actuator (18, 19), having a collecting chamber (16) that is assigned to the nozzle opening (13) and that is connected to a supply line (17) for the first liquid (A) and a supply line (21) for the second liquid (B), it being possible to block one of the supply lines (21) via a dosing valve that is able to be activated via a second actuator (24, 25), one of the two liquids being under more pressure than the other liquid.

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭258-133858

60Int. Cl.3 B 05 B 7/24 7/04

庁内整理番号 識別記号 6652-4F 6652-4F

 公公開 昭和58年(1983)8月9日 発明の数 1 審查請求 未請求

(全 10 頁)

効ガスと噴霧した液体とを接触させる方法

タング・スプリング・ドライヴ 2023

顧 昭58-10658 20特

@H 願 昭58(1983)1月27日

優先権主張 @1982年1月29日@米国(US) @344102

@発 明 者 ジェイム・サントス・サン アメリカ合衆国テキサス州7704

> 2ヒユーストン・メドウ・レイ ク10210

⑦発 明 者 ステフアン・ウエイン・ジョン ストン

アメリカ合衆国テキサス州7745 9ミズーリー・シテイー・マス

⑦発 明 者 ヘンドリックス・ヨハネス・ア ントニユス・ハセナツク

オランダ国1031シー・エム・ア **ムステルダム・バトホイスウエ** Ł 3

の出 願 人 シエル・インターナショネイル ・リサーチ・マーチヤツピイ・ ベー・ウイ

オランダ国ハーグ・カレル・ウ アン・ビラントラーン30

の代 理 人 弁理士 川原田一穂

最終頁に続く

1.発明の名称 ガスと噴霧した液体とを接触させ る方法

2. 特許請求の範囲

(1) 液体と噴霧ガスの供給を受けるように適合 された内部混合室を有すると共に、一端において は内部混合窓と各々通じ、かつ他郷においては部 **けの表面における出口の形で各々終っている、複** 数個の内部通路を有する該部材を含む内部混合噴 楊器フセンブリを通して、制膜壁を有し、かつガ スを含む接触室中に液体の小滴を往入することか らなる、該ガスと噴霧した液体とを接触させる方 佐において、該項務器アセンブリの釉に対する該 通路の角度が30°ないし75°であり、液体対喷器 ガスの质量比が!:1ないし7:1であり、そし て該出口において該接触室に入る小筒のソーター 平均縮径が200マイクロメーター以下である。 上記方法。

(2) 然いガス状の流れを冷却欲の小繭と接触さ せることによって、設定れを冷却するために上記 の方法を適用する、特許請求の範囲第(1)項記載の

(3) 噴霧ガスとして水蒸気を使用する場合に、 該 治却 旅が水である、 特許請求の範囲第(2)項記載

(4) 該熱いガス状の流れが、流動援触分解装置 から出た再生器の熱いオーバーヘッドガスの流れ からなる、特許請求の範囲第(2)項または第(3)項配 截の方法。

(5) 該無いガス状の流れが、クラウス法のオフ ガス処理プロセスにおける避元反応器に向う装入 物の流れからなる、特許請求の範囲第(2)項または 塩(3)項記載の方法。

(6) 該噴霧器アセンブリの表面において出口が 顕状に均一に配置されている、特許請求の範囲第 (1) 項ないし第(5) 項のいずれか一つに記載の方法。

(7) 接触室を通る流れを引き起こすガスと併流 方向で液体の小滴を該接触室中に注入する、特許 請求の範囲第(1) 項ないし部(6) 項のいずれか一つに 記載の方法。

特際昭58-133858(2)

(8) 出口における該小商の遊遊が臨界的であるか、または臨界的な二相の遊遊の少なくともの7 作である、特許請求の範囲第(1)項をいし第(7)項の いずれか一つに記載の方法。

(9) ソーター平均廣係が40ないし200 µm である、特許請求の範囲第(1)項をいし第(8)項のい ずれか一つに記載の方法。

(11) 隣接する各一対の出口に関して比

r;(0)+r;(0)

(ととで ri(0) かよび rj(0) はそれぞれ出口 1 かよび」の拡大直接のジェット半径であり、そして lij は出口 1 の中心と出口 1 の中心との距離であ る)

がの8よりも小さく、 そのアセンブリにおいて、比N/mα

(ことでNはアセンブリの出口の数であり、そして α はアセンブリの軸に対する内部通路と出口の 血原である)

が/5.6以下であり、そして比Xi/R

(とこて X, は出口」と、該出口から来たスプレーが / 側の出口を使用したときに制限機に衝突する 位 醒との下級に向った距離であり、そして R は制 膜臓の半径である)

が 2-7 s をいしららくの範囲である、よりな様式 で出口が互に関して位置するように、 該通路が攻 霧器内に置かれている、特許請求の範囲帯(1) 項な いし部(例項のいずれか一つに記載の方法。

3.発明の詳細な説明

ことで比較的小さなノメル間口と上述の内部進合 噴霧器に液体を高圧で通すことによって液体のス プレーが形成される。内部混合機構的は小減の寸 法をうまく制勢するだけでなく、圧力順構器と りまった数数化率を達成できるという利点を有 する。

本発明が関係する方伝においては、液体は、加

ド下にかいて破暴ダメと共化、中空の通路を通じて総合当と連続してある数数値の出りを有する内部 昭城合明線部の最ら能に供納される。故体は上記の川口を柱で収額部を至り、そして拡大しつつるスプレージェットの形で、そのスプレージェットと解放させるべきガスの流れを含む閉じられた ヤ間内に入る。

聴率的な気・散粧般を得るためには、複数化の 山を前る液体のスプレーがつぶれないとが必須 でもる。スプレーは、別えは繰り合ったよ側の ペ化の口の側の距離が小さすぎる場合化、つぶれ ふので、拡大した放体スプレーは互圧触定しすぎ っととになる。 は州等計配制能 3 8 4 3 7 5 みから のい内溶液は砂垢溶影は、上配の型のスプレー解解 を排除するの化等に達しているように造られている。この公知の混合実籍器は、r₁(0) およびr₁(0) がそれぞれ出口 | および | からの被体スプレーの 拡大直接のジェット半紙であり、そして t_i | が出 ロ | 0 中心と凹回 | 0 中心と凹距離である場合の 比

r;(0)+r;(0)

が O-8 よりも小さいようを場所に、その出口を有 している。

上記の版の別葉現象は既合演集器から離れた下 液にかけるスプレージェットと区別すべきである。 との後者の版のスプレー別載は出口の幾何字的条件かよびプまたは外部条件、例えば吹着器に沿っ で載れるガスによって引き起こされ、それによっ てジェットスプレーを至に押し合うので、スプレー は単一のジェット中に併合する傾向がある。 スプレーの掲載は別として、スプレーの無触プ ロセスにかして問題を生ずる別の別景、ナなわい。 カスがジェットスプレーを始れる以金のの知識 カスがジェットスプレーをがある以金のい。

持開昭58-133858(3)

頃(confinement wail)上に版体が衝突する現象 が存在する。スプレーの接触プロセスの置かよび 使用される版体によって、混合室の壁面上の液体 の衝突は、例えば浸食によるプロセス装置の損傷、 幅面上の枕着によるプロセスラインの開塞かよび / すたはプロセス効率の減少を報く。

本発明の目的は内部混合資源器器を使用してガスと 京幕した液体とを接触させる方法を提供するととであって、その方法では上述のスプレーの誘導と液体のの危険が実質的に排除される。 したがって、本発明は、液体と噴霧ガスの供給

を受けるように適合された内部混合室を有すると

共化、一指化かいては内部混合菌と各々適じ、かつ他端にかいては肥材(manber)の表面にかけては肥材(manber)の表面にかける 出口の形で でみ 終っている、 複数側の内部通路を 付する該部材を含む内部混合質素能でセップリッ に液体の小病を往入することからなる、試ポル 環路した。水グリの能に対ける試過路の角度が300 は溶浴でセップリの能に対する試過路の角度が300 ないしつがであり、液体対策器ガスの重股比がノ : / ないしつ: / であり、そして放出口にないて 放接検盤に入る小薬のソーター平均崩径 (Sauter mean drep diemeter) が 200 / m 以下である、上 記力接を提供する。

好ましくは、解接する各一対の出口に関して比。

/ (ことで ri(0) かよび rj(0) はそれぞれ出口 | か よび j の拡大直接の ジェット半径であり、そして tij は出口 i の中心と出口 j の中心との距離であ る)

が0.8よりも小さく、

そのアセンプリにおいて、比 N/shα

(ことで N はアセンブリの出口の数であり、そしてαはアセンブリの舶に対する内部適路と出口の 角度である)

が / 5.6 以下であり、そして比 Xi/R

(とこで Xi は出口 i と、該出口から出たスプレーが / 個の出口を使用したときに制限盤に衝突する

位置との下流に向った距離であり、そして R は制 候僚の下径である)

が2.7 5 ないしか.6 5 の範囲である、ような様式 で、出口が互に関して位置するように、該通路が 財経路内に置かれる。

本見別は多くの重要な周囲を有している。初め に、本発別と提来技術との正大な選集性、健来技 がにかいて使用されたノメルが選条圧力であって、 液体の環報が直列をとしてもった。とれらの加 形ノボルは小橋の寸法をうせく創列しなかったが、 を現のするとであった。とれらの加 で、多なには、では、の人は水藻集)は高圧であって、少病の入き こそく 側切すると とがこと に 可能となった。小鳥の寸法が大きくなるほど、弦 体とがメとの側の部を換または物型を強に受する 取問が並み 送く(したがって 観触器も越々大き() なるので、小病の すなに変異する。

依述の実施例によって示されるように、本発明 い方法はせたすぐれたスプレーパターンをもたら す。スプレーパターンは接触操作にとって極めて 重要であって、過度に広いスプレーパターンはス プレージェットを壁に直接衝突させると同時に、 過度に崩壊したスプレーはガスと十分混合しない。

液体の小洟が制限壁に衝突する危後はソーター 平均誘係を200 mm以下に選ぶことによって最小 になる。実施例で示したように本発明方法は私体 の衝突とスプレーの崩壊を生じなかった。

本発明はSCOT(Sheil Claus Off-Gas

特際的58-133858(4)

が下方に向って触線上を流れるにしたがって、二度化低泉、二硫化炭素 および紙化カルポニルを含 の成長を含物に優化水果に転化される。その敏ガ スは信期され、そして信却したガスは低化水果が 吸収されるアミン級収塔に遠される。負荷された 板収削は再生され、そして再生された 板収削は再生され、そして再生された が扱収等に使用できる。再生によって発生した緩 化本系以クラウス装骸に循環される。

SCOT法の重要な局面は避元反応器に向うガスの当底を制勢するととである。典型的には反応器の所重の組度は构えタクであるが、水東を発生させるために化学最齢的な最少下の機が使用される現情の環境にかいては減少するでは、クラの機能と接触させる前にガスの乱れを抑却するの数域を接触させる前にガスの乱れを抑却する必ずが生する。使来は、炉と反応器との間の比較的小さを(例えばタインの現剤とがはあいて、反応器との間の比較の小さを(例えばタインによりは、炉とのリカンドとの対対メルを出る

母却した。典型的には、炭素側の結合ラインの般 切の部分には耐火物をライニングする。耐火物に は無を防止するためにスプレーの頻度は此小にし なければならない。さらに、ಗ翅操作中に生放し たサワー水によってラインの凝出した炭素鋼部分 が腐失されるのを防止するために、耐火物を無打 ればならない。 従来のノズルは、無視できない量 のスプレー水が、裏打ちされてのないにで減し そとで重大な腐食の懸念を生ずるという点で消足 でなかった。

SCOT法における本発明の適用は、理想的には 炉と反応器との間の結合ラインにあり、そのノズ たは典型的には、それが結合ラインにの中心設へも あいガス状の流れの典型的な組成かよる。たびその他の 典型的な操作条件は米国等許多に/53.67年号か よび第4.90/.386号明細審かよびカナが特殊 934.937号に除ってもれちかり、これらのおれてい

る。典型的には反応器の装入物の流れを約475 でないし約290でに附却するのが望ましい。

3./37/33号明細書に記載されており、とのような条件は参考のため本明細書中に記載されている。

本発明において企図されている冷却酸は水、炭 化水素溶剤および重要炭化水素を包含してかり、 水が特に対すしい。項器ガスは水蒸気、空気、空 未、 優素およびメタンを包含しており、水蒸気が 特に針ましい。

債務ガスの圧力は、出口において合体した冷却

京・墳器ガスについて臨界的なまたはほぼ臨界的な(臨界的のの7倍)2相の速度をつくりだけのに十分でなければ改らない。水薫気を使用する割の表情を記されて過度によって過度はないように十分高くなければならない。SCOT法において使用される水薫気に関する環境が34年のには約/6.3パールである。

噴霧ガス圧力は典型的には約/6.5パールである 液体の噴霧ガスに対する重量比は、好ましくは 2:/ないし6:/の範囲にある。

多くの場合ノズルフセンブリの形は円筒形であ り、そして通路も典型的には実直でな円筒形の通路である。好ましい具体例にかいては、フセンブ りにかいて液体と実際ガスを混合するためにアラ タまたは同様な装置が使用される。

出口(および通路)の数は(各ノメルについて おるないし/2個と仮定して)通常療切に選定さ れる。それ故、出口の寸法は必要を作却能、した がって必要な作却能と喫霧ガスの量に左右された 映熱室の制限壁上に液体が衝突するのを防止し、 かつスプレーの開鍵を防止するためにはるくの毎 まを満たさをければならない。

接触室の制限壁に液体が衝突するのを防止する のにまず第一に必要な条件は、スプレー中の個々 の小儀が個々の列道について行かないでスプレー フェット中に残るような寸法を有することである。 しかも出口を去る小商のソーター平均様は200 本制以下でなければならない。ソーター平均様 (SMD) は次のように定義される。

$$SMD = \frac{\sum_{i=1}^{n} (N_i D_i^5)}{\sum_{i=1}^{n} (N_i D_i^2)}$$

との式において Ni は直径範囲 Di における小滴の数 である。

ノメルフセンブリの設計は、好ましくは小清の SMDが100 am以下になるような設計である。小 病の直径に関する典盤的な寸法は200ないし 40 am、そして好ましくは125ないし50 am である。SCOT法の好ましい具体例にかいては SMDは80 am ないし40 am である。 ソーター平均径は次の式から見積ることができ

$$\frac{\text{SMD}}{\text{de}} = 0.46 \left\{ \left(\frac{\sigma}{\text{de} G^{0}} \right) \left(\frac{\overset{\bullet}{\text{m}}_{L}}{\overset{\bullet}{\text{mg}}} \right) \left(\frac{P_{\text{mix}}}{P_{\text{g}}} \right) \right\}^{0.58} \quad (2)$$

上で使用された種々の用語は次のように定義さ

- · , 出口/個当りの液体の質量能量
- ・ mg 出口/個当りの噴霧ガスの質量流量
- Pg 噴霧ガス供給混合物 G*N/mで表わした運動量フラックス

$$2\left(\frac{2}{K+1}\right)^{1/(K-1)} \cdot P_{mix} - P_a$$

- 。 g Nで表わした、運動量流量 a_n×g", a_nは各 出口の断面積
- K 比熱の比、空気については C_p = /・40
- P。 雰囲気ガスの圧力
- d_e m で終わした相当ノズル框後 $\sqrt{4 \left(\frac{\binom{\bullet}{m_L} + \binom{\bullet}{m_g}}{\pi \rho_a \cdot G}\right)^2}$

σ N/mで表わした表面扱力 σ。 雰囲気ガスの密度

適路の角度は、大部分接触盤の個々の寸法か上 び底体と接触すべきがスの速度によって左右され る。接触室の監任が大きくなるほど、機のの側 崩また柱壁面に衝突を軽破しないで角度を基々大 きくすることができる。さらに、ガスの速度が大 きくなるほど、角度を基々大きくすることができ る。

接触盤の制限壁上に彼体が衝突するのを防止するための第二の必要条件としては、 R の比を以下に論するような成章小値に等しくするか、またはこれよりも大きくすべきである。 R は次の式から見積ることができる。

$$\frac{X_1}{R} = \frac{O./4 \rho_a \cdot V_a^2 \pi R^2}{G(\sin \alpha)^2} + \cot \alpha.$$
 (3)

この式において ρ_a , R , α および $\dot{\alpha}$ は上述のより に定義され、 V_a は雰囲気 ガスの速度である。 実施した試験から、比 $\frac{\pi}{R}$ を 2.7 5 忙等しく、 またはそれよりも大きく選んだ場合に接触監の制 膜壁にスプレーが衝突するのを阻止できることが わかった。この必要条件は後に示される実施例か ら容易に引き出すことができる。

、雰囲気ガスの与えられた密度かよび与えられた 実務器でセンブリにおいて、雰囲気ガスの速度を 変えることによって比 Tin に影響を及ぼすことが できる。雰囲気ガスの速度を増大させると、出口 から出るスプレーの外側へ低がる率が減少し、 そ れによって実務器でセンブリの制限壁にスプレー が衝突する危険が減少する。

 順携器アセンブリの軸に対する内側通路と出口の 角度を介り小さく選択するときには、混合項器器 の設計によるスプレーの崩壊が起とり得る。

上に定義した比N/maでとく5.6以下に選ぶ場合には、介籍器の陶造った設計によるスプレーの勝用が阻止される。 供籍器 アセンブリの酸と出口との角度 α は好ましくは3.5% ないしく0 側の範囲で多か。出口の数は、適当には6ないし/0 側の範囲で多数状される。 田口の数が少ないと、接触性にかける液体/ガスの接触に役立つ面積の利用効果が低下する。出口の数が10を雇えると、液体/ガス接触に役立つ面積の利用については殆ど改善されないのに、スプレーの崩壊の危険は比較的高くなる。

界画気ガスがジェットスプレーを出口から演繹 溶アセンブリの軸に向って押進める場合にもスプ レーの削壊が生じ、これは最も感覚を場合ジェッ トスプレーを単一のジェットに併合させてしまう。 たれが起きたときには、雰囲気ガスの軽く値かな ぶがしか出口からの液体と独越しない。髪後に迷 べた壁のスプレーの崩壊を防ぐためには比 $\frac{X_1}{R}$ を 5.65 K(等しく、またはそれよりも小さく選ぶべきである。 比 $\frac{X_1}{R}$ は、接触室の制度壁に液体が衝突する現象に関して前に除じたのと同じ方法で見様る。

上記のととをすべて考慮に入れると、緩胜室の 機に衝突しないで、接触室の所望の部分内で蒸発 する制御された小滴を供給する吹霧ノメルアセン ブリを設計するととができる。

本規明をより完全に説明するために総計図画を 参照する。結階図画において第/図は本発明方法 にかいて使用される内部混合圏の低体填解ノズル フセンブリの(第2図の線/-//に対った)税 画を図解してかり;第2図は門じノズルを上から みた図であり;第3図は本発明による境器器を有 する接触室の概要図であり、そして第4図は試験 結果をグラフで表わしたものである。

第/図と第2図は本発明によって使用され、そ して好ましくは円筒状の形をした複数個の通路3 と適じている混合盤2を備えた部材を含む内部温

↑ 項籍器を示している。部材/にはそれぞれ頃 が スと 放体を 窓 2 に 導入する ための 扇口 9 と 9 が 似えられている。 通路 3 は本 9 規 書 に限 明 られて いる 原理に 使って 部材 7 の中に 位 歴 が 足 められて か り、 す を わち 前 (7 − 7) に対する る。 由 成 定 は、 選当に は 3 0 2 と 0 し 7 5 で る る。 由 た は 減 知 る は 接 秘 室 (図 房 マ ナ ツ) に 配 日 して い な 、 / 水 ル 7 セ ン ブ り は フ ラ ン ツ 接 級 8 の 便 用 に よ って 摂 熱性 室 に つ な ぐ と と が で き る。

 本発明は以下の実施例によってさらに詳しく説 明される。

実施例

が認23 によって制定し、これを Va(m/m)と して表の中に記録する。エルポの下流に種々のノ ズルフセンブリ 2 年を挿入し、東郷空気の供給 25とは却水の供給 2 4 も用意した。

(以下余白)

ノスル (kg/s) (bar) (kg/s) (bar) (m/s) (N) (m^2x/O^{-4}) (kg/m³) / 40°-/0¹) 0.23/9 /6.6 0.6364 /2.2 /2.5 23.3 0./967 /5.56 /.28 3.46 衝突なし 崩壊なし 2 40 - 10 1 0 - 23 19 16 - 5 0 - 63 64 12 - 4 7 - 0 23 - 8 0 - 19 67 15 - 56 1 - 28 1 - 99 3 40°-101 0.1297 9.15 0.2897 5.5 6.7 10.3 0.1967 15.56 1.28 2.71 4 40°-/01) 0./297 8.94 0.2897 5.5 /2.8 /0.3 0./967 /5.56 /.28 6.38 . 5 40°-9 0.1297 9.01 0.2897 5.4 /2.8 //-2 0.2/92 /4.00 /.28 5.97 衝突なし、崩蔽なし 0.1297 9.01 0.2961 5.8 6.4 12.4 0.2192 14.00 1.28 2.37 制製壁に衝突;ジェットは 40°-9 0.23/9 /6.6 0.6364 /2.4 //.9 26.6 0.2/92 /4.00 /.28 2.63 制限盛に衝突;ジェットの衝 40°-9 / .28 2.63 副発生に / .28 2.03 制限症に衝突; V =/0.36 m/s, X / R=2.6 におい て衝突も削減をなし 40-9 0.23/9 16.6 0.6364 12.4 7.6 26.6 0.2/92 14.00 て衝突も19 40-8 0./347 9.43 0.2836 5.8 72.5 /3.9 0.2452 /2.45 /.28 4.88 衝突左し 40°-8 0./347 9.43 0.2836 5.8 7.3/ /3.9 0.2452 /2.45 /.28 2.53 前膜腺に衝突 un°-8 0,228/ /6.6 0.6364 /2.7 /2.2 30.8 0.2452 /2.45 /.28 2.84 制限機に衝突 0.228/ /6.6 0.6364 /2.7 23.2 /8.2 0.2452 /2.45 0.65 5.85 スプレー崩壊 12 40°-8 35°-/0 0.23/9 /6.3 0.6364 /3.8 /2.8 27.3 0./967 /7.54 /.28 3.98 スプレー崩壊 35-10 0.2/06 /6.0 0.6552 /2.0 7.3 /7.9 0./967 /7.54 /.28 2.78 0./347 9.43 0.296/ 5.7 7.0 8.4/ 0./967 /7.54 /.28 3.93 . 35°-10 0./347 9.43 0.296/ 5.7 /2.5 8.4/ 0./967 /7.54 /.28 8.98 .

表(つづき)

選転 ノズル 参号	m e	Pg	m.	$P_{\mathcal{L}}$	v _a	Ġ	a _n	$N_{\text{stn}}\alpha$	$\rho_{\rm B}$	X _i /R	往
	(kg/s)	(bar)	(kg/a)	(bar)	(m/s)	(N)	(m ² x/0 ⁻⁴)		(kg/m ³)	
17 50°-10	0./3//	9.29	0.2961	5.7	11.9	10.9	0.2007	12.99	1.28	3.82 1	突なし、崩壊なし
18 50°-10	0./3//	9.15	0.3/50	5.7	7.3	10.8	0.2007	12.99	1.28	2.02 1	段艦に衝突;

- /9 50~/0 0-23/9 /6.6 0-6/75 /2-4 /2-8 24-6 0-2007 /2-99 /-28 2-4/ 制限線に衝突
- 20 50°-/0 0.2267 /6.0 0.6/75 //.7 7.0 22.8 0.2007 /2.99 /.28 /.40 制限線に衝突
- 2/ 40°-/0²) 0./347 8.74 0.2772 5.8 8.23 //./ 0./967 /5.56 /.28 3.26 衝突なし、崩壊なし
- 22 40~102) 0./347 8.74 0.2772 5.8 5.48 //./ 0./967 /5.56 /.28 2./8 制限版に衝突
- 23 45~10 0.1347 8.74 0.2772 5.8 23.20 14.8 0.1967 14.14 0.65 5.70 ステレー崩壊
 - /) 操作中冷却液に若干量の接線方向の運動量が加えられるように、4°片岩ったノメルチップ
 - 2) 面に対して直角な穴を有するノボルチップ

各々の選転について、小筒のソーター平均資径 は200 umよりも小さかった。上に示したように 4発明方法において使用したスプレーノメルはす ぐれたパターンを有していた。これらのすぐれた 結果は、板めて困難な道用、すなわち垂直断面に おいて有効を耐火物ライニングを約5.5 m しか持 たない値か0.96mの内径の耐火物ライニング炭 前銅ラインにかいて得られた。50°-10ホール のチェアによる4つの場合のうちの3つの場合に ついては、極端を場合ダクト壁にスプレージェッ トが直接衝突し、35°-10ホールのチップによ る包囲ガスの貧弱な飛沫同伴によってスプレーは 川塘するととが示される。多くの場合ダクトの中 の空気の速度を 4.6 ない し 9.2 m/a に調整すると とによってダクトの壁からスプレージェットを移 動させて難すことができた。本発明によって使用 されるノメル、すをわち40-10ノメルチップ はほどょく広いパターンを生することが判明し、 ベクトの空気流量が約半分よりも少なくなるまで

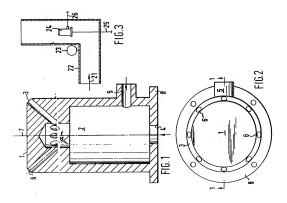
表に挙げた試験結果をグラフにして第4図に示 す。この第4図にかいて、比X_I/RをX軸上にプロットし、比N/由αをY軸上にプロットした。この 図で使用した符号は下記の意味を有する:

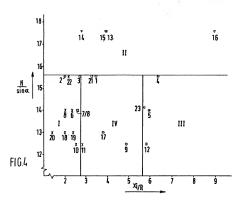
- O 噴霧器の表面に対して直角な内部通路を有するノズルにより、衝突も崩壊もない。
- ◆ 4°片寄った内部通路を有するノメルにより、 衝突も崩壊もない。
- ム 制限壁に衝突
- マ ノズルの設計によるスプレーの崩壊
- □ 包囲ガスの成人によるスプレーの崩壊 第半回では4つの領域、ナなわち、領域 1: 対 収穫に対するスプレーの崩壊、領域 目: ノズルの 設計によるスプレーの崩壊、領域 目: 包囲ガスの 影響によるスプレーの崩壊かよび領域 N: 領突も 助機もなし、に分けることができる。 4公司の必頼なお単編

経附関而の第 / 図は本発明において使用される 内部 髙合型の 龍体 東霧ノメルアセンブリの 板削 面 図であり、第 2 図はそのノメルアセンブリの 平崩 図であり、第3図は本発明による関係器を有する 接触盤の概要図であり、そして第4図は本発明の 効果を示す試験結果をグラフで表わしたものであ る。

/ …部材、 2 … 混合室、 3 … 通路、 4 , 5 … 間口、 6 …出口、 8 … フランジ結合、 2 2 … ダクト フセンブリ、 2 3 … 洗量指示器、 2 4 … ノズルフ センブリ。

代理人の氏名 川原田 一 穂





第1頁の続き 優先権主張 ②1982年11月15日③イギリス (GB)①8232534